

附表二

| 燃料種類 | | 公私場所應具備之設施 | 公私場所應採用之防制設施 | | 施行日期 | |
|----------|-----------|--|--|------------------------------|----------|--|
| | | | 粒狀物、氮氧化物、硫氧化物 | 戴奧辛 | 新設污染源 | 既污染源 |
| 固體再生燃料 | 第一類固體再生燃料 | 水泥旋窯、流體化床式鍋爐或其他經直轄市、縣（市）主管機關同意使用之設施。 | 粒狀物：袋式集塵器、靜電集塵器。 | - | 發 布 日 | 中 華 民 國 百 五 一 一 年 十 月 日 |
| | 第二類固體再生燃料 | | 硫氧化物：排煙脫硫技術、洗滌塔。 氮氧化物：低氮氧化物燃燒器、煙道氣迴流技術、分段燃燒技術、選擇性觸媒還原技術、選擇性無觸媒還原技術。 | 活性碳注入設備、驟冷塔、觸媒、陶瓷濾管、集塵器、觸媒袋。 | | |
| 廢棄物再利用燃料 | | 應符合中央主管機關或主管機關所公告之事業廢棄物再利用規定、經直轄市、縣（市）主管機關核准或廠內自行再利用之規範。 | 粒狀物：袋式集塵器。 硫氧化物：排煙脫硫技術。 氮氧化物：選擇性觸媒還原技術。 | | | |

備註一：公私場所固定污染源因情形特殊採用燃料、製程操作條件最佳化、新型式技術，未能採用表列應採行之防制設施者，得檢具

符合排放濃度之佐證資料，報請直轄市、縣（市）主管機關同意後為之。

備註二：採用活性碳注入設備降低戴奧辛排放量者，需記錄每小時活性碳注入量。正常操作時之活性碳注入量不得低於最近一次採樣分析符合戴奧辛排放標準期間所使用同一規格活性碳之平均每小時注入量，若操作時變更活性碳規格或減少其注入量，應重新進行戴奧辛採樣分析，測定注入量之下限值。